



Agency Contact:

David Moreno

MCA

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: dmoreno@mcapr.com

**D2S 社とニューフレアテクノロジー社は電子ビーム コンピュータ設計プラットフォームの
先端フォトマスク向け導入加速化のため関係を拡張**

SAN JOSE, Calif., September 9, 2013- コンピュータ設計プラットフォームを供給する D2S®社 は、本日、汎用グラフィック処理ユニット (GPGPU) を利用した将来世代の先端フォトマスクの描画時間削減と精度向上を目的とした eBeam 技術の開発を加速化するため、電子ビーム (eBeam) マスク描画装置の世界的リーダーであるニューフレアテクノロジー社 (以下、ニューフレア社) とのパートナーシップを拡張したと発表した。本合意の一環として、ニューフレア社は D2S 社に投資を行うとのこと (金額は非公開)。ニューフレア社は、Benchmark Capital 社、DAG Ventures 社、Samsung Ventures 社、グローバルベンチャーキャピタル社ら既存出資者の中に加わることとなる。

加えて、D2S 社の [TrueMask® DS GPGPU 加速化プラットフォーム](#) が、ニューフレア社の社内利用を目的として採用されたことも発表された。D2S 社は、TrueMask DS プラットフォームの拡張性を生かし、ニューフレア社の科学研究や技術開発をサポートする拡張機能を開発する。

今日、全ての半導体デバイス製造に利用されている eBeam 技術は、より微細なノードに進むことにより、半導体エコシステムの中でますます重要となってきた。また、先端チップ設計でのフォトマスク製造に求められる設計データ量は、指数関数的に増大している。その結果、マスクのサプライチェーンに対するコスト維持圧力に加え、これら先端マスクの描画時間を現実的な時間内に収めることが、マスク描画システムに対し強く求められている。

2011 年、[D2S 社とニューフレア社とのパートナーシップ](#) は、現実的な描画時間内に複雑なマスクパターンの描画を可能とするため、重ね合わせのある eBeam ショットをニューフレア社製装置の上で実現するために開始された。マスク設計の複雑さとマスク精度維持への要求がますます増大する中、[モデルベースのマスクデータ準備 \(MB-MDP\)](#) のための D2S 社の TrueMask GPGPU ベース コンピュータ設計プラットフォームのような新たなイノベーションは、増大する複雑なマスク形状への需要に応えながらフォトマスクコストの削減や描画時間の削減を実現するために必要とされている。

“GPGPU ベースの eBeam 技術は、弊社の将来技術向け重点投資エリアとなります” とニューフレア社描画装置統括部企画室 室長の山田裕和氏は述べた。“弊社は、D2S 社が TrueMask eBeam シミュレーション技術に対し採っているアプローチが広い範囲の応用性を十分に有すると考えています。そして、弊社は、eBeam 技術のエコシステム全体に貢献するために、その様なアプローチを採る企業の開発努力をサポートいたします。”

“マスク業界は、ムーアの法則に従い ますます増大する精度と工期 (TAT) への要求に対し責任を背負う必要があります。業界リーダーであるニューフレア社がコミュニティに対し投資活動を行うことは誠に素晴らしいことでもあります” と D2S 社 CEO Aki Fujimura 氏は述べた。“この度の投資は、これら増大する要求に対応するために、弊社 TrueMask GPGPU 高速 eBeam シミュレーションプラットフォームの採用機会を増やすことになると考え、よって、お客様により大きく貢献するが可能となります。”

About D2S, Inc.

D2S 社は、少量生産および大量生産のアプリケーションの双方に対し、マスクコスト削減を実現することで既存の eBeam 技術の効果を最大化するコンピュータ設計プラットフォームのサプライヤーです。D2S 社の TrueMask ソリューションは、28nm およびそれ以下の世代に対し、より優れたウエハ品質を得るための複雑なパターン形状を先端フォトマスク設計に利用することを、既存 eBeam マスク描画装置を用いて、また、現実的なコスト範囲内の描画時間で実現するソリューションです。D2S 社は、eBeam Initiative の事務局です。本社は米国カリフォルニア州サンノゼ市にあり、創業 2007 年の会社です。詳しくは www.design2silicon.com を参照ください。

###

D2S、D2S ロゴは D2S, Inc. 社の米国登録商標です。また TrueMask は D2S, Inc. 社の登録商標です。